

(43) 国際公開日
2009年4月2日 (02.04.2009)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2009/041618 A1

(51) 国際特許分類:

G11B 5/73 (2006.01) C03C 3/097 (2006.01)
C03C 3/087 (2006.01) C03C 21/00 (2006.01)
C03C 3/095 (2006.01) G11B 5/84 (2006.01)

(21) 国際出願番号: PCT/JP2008/067489

(22) 国際出願日: 2008年9月26日 (26.09.2008)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:

特願2007-255139 2007年9月28日 (28.09.2007) JP
特願2007-255319 2007年9月28日 (28.09.2007) JP
特願2007-314521 2007年12月5日 (05.12.2007) JP

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): HOYA 株式会社 (HOYA CORPORATION) [JP/JP]; 〒1618525 東京都新宿区中落合2丁目7番5号 Tokyo (JP).

(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてののみ): 越阪部 基延 (OSAKABE, Kinobu) [JP/JP]; 〒1618525 東京都新宿区中落合2丁目7番5号 HOYA株式会社内 Tokyo (JP). 磯野 英樹 (ISONO, Hideki) [JP/JP]; 〒1618525 東京都新宿区中落合2丁目7番5号 HOYA株式会社内 Tokyo (JP). 岩田 勝行 (IWATA, Katsuyuki) [JP/JP]; 〒1618525 東京都新宿区中落合2丁目7番5号 HOYA株式会社内 Tokyo (JP). 江田 伸二 (EDA, Shinji) [JP/JP]; 〒1618525 東京都新宿区中落合2丁目7番5号 HOYA株式会社内 Tokyo (JP). 寺田 研一郎 (TERADA, Kenichiro) [JP/JP]; 〒1618525 東京都新宿区中落合2丁目7番5号 HOYA株式会社内 Tokyo (JP).

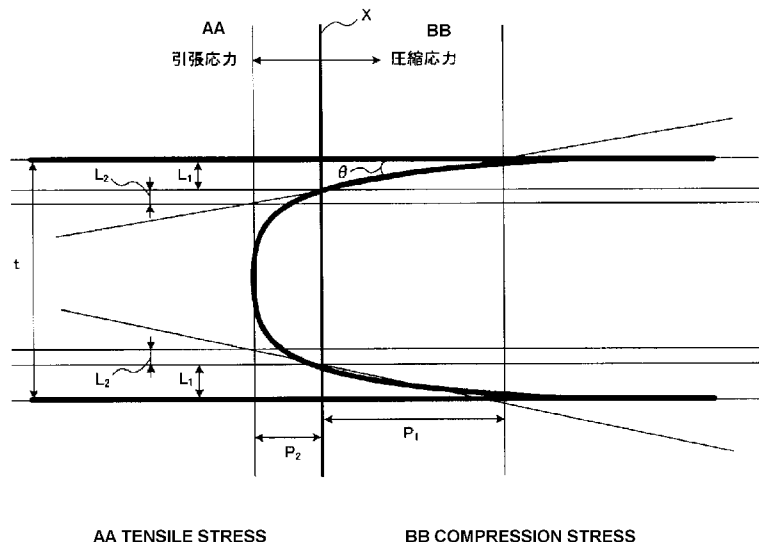
(74) 代理人: 青木 宏義, 外(AOKI, Hiroyoshi et al.); 〒1020084 東京都千代田区二番町4番3 二番町カシュビル 7 F Tokyo (JP).

[続葉有]

(54) Title: GLASS SUBSTRATE FOR MAGNETIC DISK, PROCESS FOR PRODUCING THE GLASS SUBSTRATE, AND MAGNETIC DISK

(54) 発明の名称: 磁気ディスク用ガラス基板及びその製造方法、磁気ディスク

[図1]



(57) Abstract: This invention provides a glass substrate for a magnetic disk. The glass substrate has a main surface and an end face, has been subjected to chemical strengthening treatment and is in a disk form. The glass substrate is characterized in that the penetration length in the stress layer in the uppermost part on the main surface is not more than $49.1 \mu\text{m}$, and the glass substrate satisfies a y value of not more than the penetration length in the stress layer in the uppermost part on the main surface. The y value is defined by the following formula: $y = \{12 \cdot t \cdot \ln(\tan \theta) + (49.1/t)\}$ wherein θ represents an angle of the main surface to the compression stress in a stress profile as measured by a Babinet compensator method.

(57) 要約: 本発明の磁気ディスク用ガラス基板は、主表面及び端面を有し、化学強化処理が施された円盤状の磁気ディスク用ガラス基板であって、前記主表面の最表部応力層押し込み長が $49.1 \mu\text{m}$ 以下であり、バビネ補正器法による応力プロファイルにおいて前記主表面と圧縮応力との間のなす角を θ としたときに、 $\{12 \cdot t$

[続葉有]



(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD,

SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:
— 国際調査報告書